Vol.31, Suppl. March, 2004

文章编号: 0258-7025(2004)Supplement-0477-03

1064 nm 偏振薄膜的激光损伤特性

胡建平,马平,许乔,张问辉,段利华 (成都精密光学工程研究中心,四川成都 610041)

摘要 实验研究了偏振膜的 0°和 56°角激光损伤特性。研究表明,对于未镀 SiO₂ 覆盖层的偏振膜,S 和 P 激光 0°和 56°角入射的损 伤图貌为疤痕和膜层剥离,而对于镀 SiO₂ 覆盖层的偏振膜,0°和 56° S 偏振光的激光损伤主要为疤痕,56° P 偏振光的激光损伤为 30~50 μm 的孔洞,孔洞形成的原因与深入基片亚表面的抛光粉微粒有关。

关键词 激光技术; 激光损伤; 偏振膜; SiO2 覆盖层

中图分类号 TN24; O484.4 文献标识码 A

Laser Damage Properties of Polarizers Coatings at 1064 nm

HU Jian-ping, MA Ping, XU Qiao, ZHANG Wen-hui, DUAN Li-hua (Chengdu Fine Optical Engineering Research Center, Chengdu, Sichuan 610041, China)

Abstract The laser induced damage of polarizer has been studied by use of 1064 nm laser with 10 ns pulse duration at the incident angle of 0° and 56°. The experiment results show that the damage morphology is scald and delamination for polarizer coating without SiO₂ overcoat and with SiO₂ overcoat when laser incident at angle 0° and 56° for *S* polarization light. For *P* polarization light, the damage of polarizer with SiO₂ overcoat is mainly pits about 30~50 μ m in size caused by polishing powder, and the pit size is almost independent on the energy density of the incident laser.

Key words laser technique; laser damage; polarizer; SiO₂ overcoat

1引言

偏振膜是高功率激光器中的重要光学元件之一,其抗激光损伤能力对于高功率激光系统是一个 关键的技术指标,其激光损伤阈值的大小直接影响 激光器的输出功率和性能^{III}。

偏振膜的抗激光损伤能力与多种因素有关,主要与镀膜材料、镀膜工艺、薄膜中的电场分布、膜系设计、激光波长和脉宽等因素有关^[2,3]。国内外研究表明,高损伤阈值的激光薄膜采用HfO₂/SiO₂ 膜料组合在同样的镀制条件下,效果最佳^[4],另外,SiO₂ 覆盖层也是提高激光薄膜损伤阈值的重要手段^[9]。

本文主要研究光学中心镀制的 1064 nm 偏振 膜的激光损伤特性。用 1-on-1 激光损伤方式,针对 不同的偏振膜样品,研究了 0°和 56°入射角的偏振 膜的激光损伤形态及特性。

2 实验条件及方法

2.1 薄膜样品

镀膜基片为 \$40 mm×5 mm 的 K9 光学玻璃,基

片的表面均方根粗糙度小于 1.0 nm,基片镀膜前用 酒精和丙酮清洗干净。

实验用偏振膜采用 HfO₂/SiO₂ 膜堆,用真空电 子束蒸镀而成。偏振膜的中心波长为 1054 nm,偏振 片的使用角度为 56.5°,其光谱曲线如图 1 所示。偏 振片样品分两种,最外层加镀和不加镀 SiO₂覆盖层。



2.2 实验装置和方法

激光损伤阈值测量系统是由单纵膜 Nd:YAG 调 Q激光器,He-Ne 准直光源,分光光楔,3 m 聚焦凸 镜,可移动样品平台,能量计和 CCD 光束分析仪组

作者简介: 胡建平(1964-),男,成都精密光学工程研究中心副研究员,主要从事光学元件激光损伤研究。 E-mail:hujp2000@sohu.com



图 2 偏振膜 0°的激光损伤形貌 Fig.2 Laser damage morphologies of polarizer at 0° incident

成。测试激光由 Nd:YAG 调 Q 脉冲激光器输出, 激光输出模式 TEM₀₀, 波长 1064 nm, 脉宽(FWHM) 为 10 ns, 最大脉冲能量 1.5 J, 能量稳定度为±5%, 样品平台可 X-Y-Z 三方向移动和水平面旋转, 能保证测试光斑在薄膜不同区域和以偏振角 56.5°进行激光损伤测试。激光能量用美国 EM500 大能量探头能量计测量, 测量精度约±1%, 测试点光斑的有效面积用 CCD 光束分析仪测量, 测得光斑平均等效面积为 0.66 mm²。

薄膜的激光损伤实验主要采用单次激光脉冲照 射样品薄膜唯一点的——对应即 1-on-1 方式,激光 损伤图貌用莱卡的 Normaski 显微镜分析。损伤实验 激光光束的入射角为 0°和 56.5°,入射激光为 P 和 S 偏振光,激光损伤能量密度从小到大,每一激光能量 密度测试 10 个点,能量之间的增量为 5 J/cm²。

3 实验结果与分析

3.1 激光损伤图貌

偏振膜的 0°激光入射角损伤如图 2 所示,从图 中可以看出,加镀 SiO₂ 覆盖层和没有加镀覆盖层的 激光损伤图貌与 1064 nm 高反膜的激光损伤图貌相 似¹⁰,实质上,1064 nm 偏振膜 0°使用即是 1064 nm 高反膜。而加镀 SiO₂ 覆盖层的膜面激光损伤尺度 小,基本上为烧伤疤痕,没有层裂发生。而没加镀 SiO₂ 层的激光损伤尺度大,而且对于激光能量大,或多次激光打击,还形成膜层剥离。

56°角 P 偏振光对偏振膜的激光损伤图貌如图 3 所示,可以看出,没有加镀 SiO2 覆盖层的偏振膜 的激光损伤图貌与其 0°入射角的激光损伤图貌相 似,基本表现为激光烧伤疤痕和表层薄膜的剥离,只 是由于 56°角入射, 烧伤面为椭圆面。 而加镀 SiO2 覆 盖层的偏振膜的激光损伤图貌与 0°相比, 相差较 大。在低能量密度的激光作用下,薄膜损伤为孔洞, 表面没有烧伤疤痕,中等能量密度的激光损伤主要 为孔洞,有时也有膜面烧伤疤痕,但与孔洞的相关性 不大,说明损伤的机理不一样。高能量密度的激光损 伤除了形成孔洞和疤痕外,还有薄膜表层剥离现象发 生。无论是低能量密度还是高能量密度的激光损伤, 对于加镀 SiO2 覆盖层的偏振膜, P 偏振光 56°角入射 对薄膜的激光损伤形态的一个显著特点就是形成孔 洞,孔洞的大小在 30~50 µm 左右,并且随激光能量 密度的增加变化较小。例如.激光能量从 15 J/cm² 增



图 3 56°人射偏振光对偏振膜的激光损伤形貌 Fig.3 Laser damage morphologies of polarizer at 56° incident

加到 33 J/cm²,随着激光能量的不同,薄膜表面会出现疤痕和薄膜表层剥离,但孔洞的大小基本相同。

偏振膜 S 偏振光的 56°激光损伤图貌与各自的 0°激光损伤图貌相似,表现为疤痕和膜层剥离,只是 由于激光倾斜入射,损伤面为椭圆形。

3.2 损伤图貌分析

从激光损伤图貌可以看出,偏振膜的激光损伤 对于S偏振和P偏振光主要表现为疤痕、膜层剥离 和孔洞,但对于是否镀了 SiO2 覆盖层,损伤的形式 各有侧重。没有镀 SiO2 覆盖层的偏振膜,对于 S 偏 振和 P 偏振光的 0°和 56.5°角入射, 主要表现为疤 痕和膜层剥离,激光损伤为最外层的 HfO2 膜层烧 伤,烧伤过程中产生强等离子体闪光,初始损伤耐激 光连续打击能力差。而镀 SiO₂ 覆盖层的偏振膜,对 于0°入射激光,损伤主要表现为疤痕,并且耐激光 连续打击能力强。对于 56.5°入射激光, S 偏光的激 光损伤主要表现为疤痕,而P偏振光的一个显著振 的激光损伤特点是孔洞,孔洞的形状均为圆形,大小 较一致,约30~50 µm 左右,与激光能量密度高低的 关系不明显,可以推断出孔洞形成的机理应该相同。 孔洞形成的原因与微小颗粒吸收激光能量有关,膜 层中的颗粒主要为膜料镀制过程中形成,其损伤特 点是形成孔洞,并以孔洞为圆心形成烧伤疤面四,孔 洞和疤痕的形成相关。从这一点看,偏振膜激光损 伤产生的大部分孔洞不是由膜层中的节瘤缺陷造成 的,应与基片和薄膜交界面上的吸收微粒有关。基 片在抛光过程中,有少量抛光粉残留在基片表面和 深入基片亚表面,形成均匀分布。由于抛光粉微粒 大小均匀,位于基片表面及亚表面,因而由其引起的 激光损伤形成的孔洞表现为大小基本一致,且与激 光能量关联不大。至于未加镀 SiO₂ 覆盖层的偏振 片,56°入射角的激光损伤形态未出现孔洞现象,而 与其0°入射角的激光损伤形态相同,主要是因为 HfO2膜层容易烧伤形成等离子体闪光,等离子体闪 光对激光脉冲的激光能量有屏蔽作用,使得激光到 达基片表面能量较低,因而孔洞形成的少。

参考文献

- 1 M. R. Kozlowski, I. M. Thomas, J. H. Campbell *et al.*. Highpower-optical Coatings for a Mega-Joule Class ICF Laser [C]. *SPIE*, 1992, **1782**: 105–119
- 2 F. Y. Genin, C. J. Stolz, T. Reitter *et al.*. Effect of Electric Field Distribution on the Morphologies of Laser–Induced Damage in Hafnia–Silica Multilayer Polarizers[R] UCRL–JC–124873, 1997
- 3 C. J. Stolz, F. Y. Genin, T. A. Reitter *et al.*. Effect of SiO₂ Overcoat Thickness on Laser Damage Morphology of HfO₂/SiO₂ Brewster's Angle Polarizers at 1064 nm[R] UCRL-JC-124875, 1997
- 4 C. Fournet, B. Pinot, B. Geenen *et al.*. High Damage Threshold Mirrors and Polarizers in the ZrO₂/SiO₂ and HfO²/SiO² Dielectrics Systems [C]. SPIE, 1991, **1624**:282~293
- 5 Fu Xiongying, Kong Mingdong, Hu Jianping. The deposition of high threshold reflecting coating with high damage threshold for 1064 nm pulse laser [J]. *High Power Laser and Particle Beams*, 1999, 11(4).413-417

付雄鹰,孔明东,胡建平. 波长 1064 nm 脉冲激光高阈值反射膜的 研制[J].强激光与粒子束,1999,11(4): 413~417

- 6 Hu Jianping, Qiu Fuming, Fu Xiongying et al. Effect of λ/2 silica overcoat on laser damage of HfO₂/SiO₂ high reflecting coating [J].*High Power Laser and Particle Beams*, 2001, **13**(2).137~141 胡建平,邱服民,付雄鹰等. SiO₂ 半波覆盖层对 HfO₂/SiO₂ 高反射 膜激光损伤的影响[J].强激光与离子束,2001, **13**(2):137~141
- 7 Hu Jianping, Chen Mei, Fu Xiongying et al.. Relation between laser damage and defects of HfO₃/SiO₂ HR coating [J]. High Power Laser and Particle Beams, 2001, 13(5):529~532 胡建平,陈 梅,付雄鹰等.HfO₃/SiO₂ 高反射膜的缺陷及其激光损 伤[J]. 强激光与粒子束, 2001, 13(5):529~532